LELEC 1755 Compléments d'électricité

Partie 2 : Dispositifs électroniques
Prof. Denis Flandre
ICTEAM / ELEN (microélectronique)

Bâtiment Maxwell E-mail : denis.flandre@uclouvain.be

2020-2021 D. Flandre

1

Table des matières

- introduction
- conduction dans les solides
- semi-conducteurs et dopage
- jonction PN
- Technologie ?
- transistor bipolaire à jonctions
- transistor MOS
- circuits intégrés ?

2020-2021 D. Flandre 2

2

La conduction dans les solides

une tension ou différence de potentiel va produire un courant, qui est le déplacement de charges sous l'action du champ électrique introduction
 conduction dans les solides
 semi-conducteurs et dopage

jonction PNtechnologie

transistor bipolaire transistor MOS

circuits intégrés

ces charges sont :

dans le vide : des électrons libres

dans un gaz ionisé : des électrons libres + des ions chargés

positivement

dans un liquide : des ions positifs et négatifs

dans un solide : grande variété de porteurs de diverses mobilités

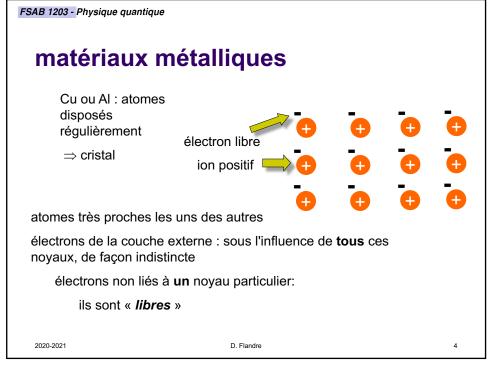
· conducteurs

· isolants

· semi-conducteurs

2020-2021 D. Flandre 3

3



4

Porteurs libres dans un métal?

 $E_F = \mu$ (potential chimique)

$$(\mu-E_c)_0=\frac{h^2}{8m_c}\left(\frac{3n}{\pi}\right)^{2/3}$$

Métal	Na	K	Ag	Cu
$(\mu - E_c)_0 \ (eV)$	3,1	2, 1	5,5	7,2

Si la distance interatomique d d'un métal monovalent de structure cubique est connue (à l'aide de méthodes de diffraction de rayons X par exemple), alors $n = 1/d^3$

2020-2021 D. Flandre 5

5

FSAB1201 Physique 1

mouvement des électrons (Brownien)

électrons libres = électrons de conduction

- · zéro absolu : pas d'opposition au mouvement
 - ⇒ résistance nulle (supra-conductivité)
- température

 vibration des ions et mouvement des électrons + collisions (élastiques et non-élastiques) et échanges d'énergie :

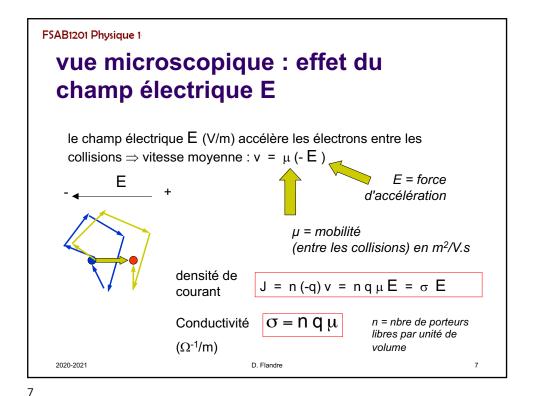


à l'équilibre : déplacements aléatoires

⇒ mouvement moyen nul = pas de courant

2020-2021 D. Flandre 6

6



vue macroscopique : le courant dans un barreau courant I = J A avec A = w * d $R = \frac{V}{I} = \sigma^{-1} \frac{L}{A} = \rho \frac{L}{A} = \frac{1}{G}$ • σ : conductivité du matériau [Ω^{-1}/m]
• $\rho = 1/\sigma$: résistivité du matériau [Ωm]

exemple de valeur : $\rho = \sigma^{-1} = 1.73 * 10^{-8} \Omega m à 20^{\circ} C$ pour Cu ~ 1 électron libre (= porteur) / atome $\sim 10^{23}$ atomes / cm³

effet de la température

si la température augmente :

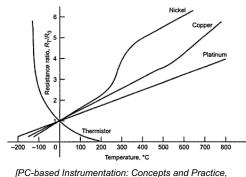
- les électrons bougent de plus en plus facilement : leur mobilité peut augmenter
- mais ils se cognent aussi plus aux autres, ce qui les freine : leur mobilité peut diminuer
 - ⇒ la résistance peut augmenter ou diminuer, selon la gamme de températures et la nature du matériau.

2020-2021 D. Flandre 9

9

capteur de température : Pt-100

Résistivité (20 ° C) \approx 100 n Ω ·m (\approx 6x plus que le Cu)



[Springer handbook of materials measurement methods,

Horst Czichos, Tetsuya Saito, Leslie Smith, 2006]

2020-2021 D. Flandre 10

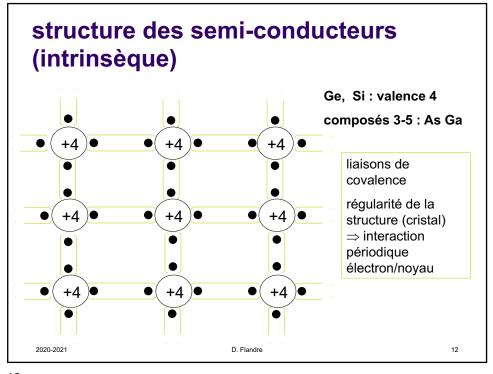
10

Semi-conducteurs et dopage

- introductionconduction dans les solidessemi-conducteurs et dopage
- □ jonction PN□ technologie
- transistor bipolaire à jonctionstransistor MOS
- circuits intégrés
- structure du semi-conducteur
- dopage n et p
- génération et recombinaison
- emission de lumière
- concentration et potentiel
- flux de courant

2020-2021 D. Flandre 11

11



12

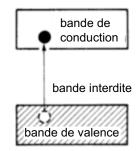
porteurs libres

seuls certains niveaux d'énergie sont permis pour les électrons : niveaux quantifiés

énergie nécessaire pour "sauter" :

$$E_g$$
 = 1.124 eV pour Si 0.67 eV pour Ge

il existe 2 types de porteurs libres : électrons et trous



• génération G :

génération thermique

$$\Rightarrow probabilit\acute{e} = K \left(e^{\frac{-qV_g}{kT}} \right) \qquad \varphi_T = \frac{kT}{q} = 0.026 \frac{T}{300} \ [V]$$

influence de la lumière, du potentiel appliqué ...



2020 2021

D. Flandre

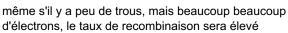
13

13

génération et recombinaison

• taux de recombinaison R :

dépend du nombre de porteurs actifs (libres) présents



$$R = r n p$$
 avec $r = constante du matériau$



équilibre des porteurs libres

à tout moment, il y a génération et recombinaison

à l'équilibre, c.-à-d. sans tension appliquée, ni apport externe de porteurs (courant), génération = recombinaison :

$$p n = n_i^2$$

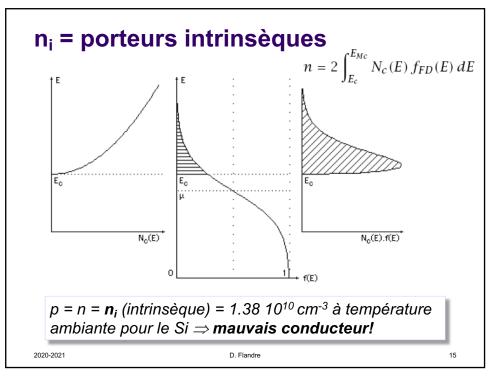
valable à l'équilibre, quel que soit le dopage

2020-2021

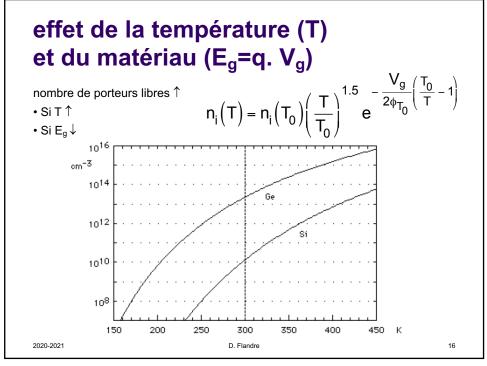
D. Flandre

14

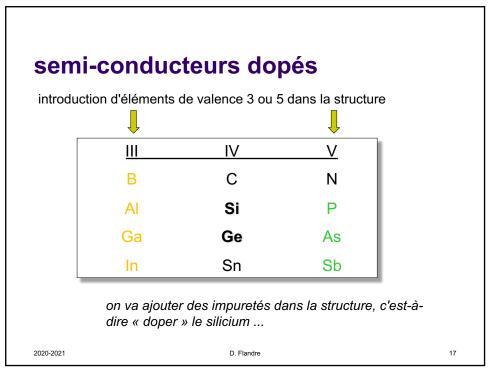
14



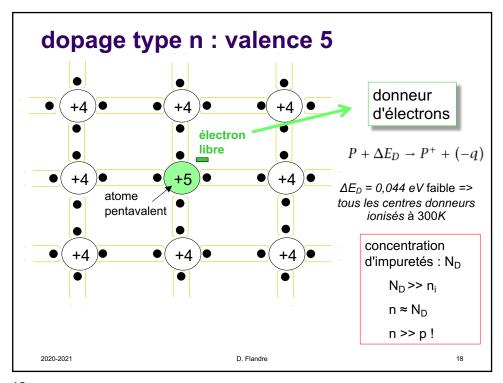
15



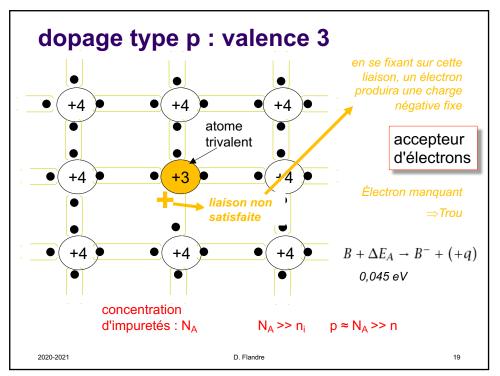
16



17



18



19

majoritaires et minoritaires

• soit un semi-conducteur dopé n :

$$N_d >> n_i \text{ et } n_n \approx N_d$$

toutes les impuretés sont ionisées: les électrons sont les « majoritaires »

$$p_n = \frac{n_i^2}{n_n} = \frac{n_i^2}{N_D} \ll n_n$$
 le courant sera principalement dû aux **électrons**

les trous sont les « minoritaires »

• soit un semi-conducteur dopé p : les trous sont les « majoritaires »

$$N_a >> n_i$$
 et $p_p \approx N_a$
$$n_p = \frac{n_i^2}{p_p} = \frac{n_i^2}{N_A} \ll p_p$$
 le courant sera principalement dû aux *trous*

les électrons sont les « minoritaires »

2020-2021 D. Flandre 20

20

neutralité électrique globale à l'équilibre

Densité de charge d'espace $\rho(x) = q [p(x) - n(x) - N_A + N_D]$

Ex.: Bloc de semiconducteur homogène isolé dopé P (N_A, N_D=0)

Si N_A

Q = 0!

en tout point :

 $p \approx N_A$ $n \approx 0$

 $\rho(x) = 0 !!!$

2020-2021

D. Flandre

21

21

niveau de Fermi

Semiconducteur intrinsèque :

$$\phi_F = (E_F \text{-} E_i)/q = 0$$

E_g E_F:

 $E_F = E_i = E_g/2$

 $(p = n = n_i)$

SC dopé N:

$$\begin{split} &N_D^+ = N_D = n, \quad p = n_i^2/N_D \\ &E_F = E_i + kT. \, In \bigg(\frac{N_D}{n_i}\bigg) \\ &\varphi_F = \varphi_T. \, In \bigg(\frac{N_D}{n_i}\bigg), \quad \varphi_T = \frac{kT}{q} \\ &n_O = N_D = n_i \cdot e^{-\varphi_T} \end{split}$$

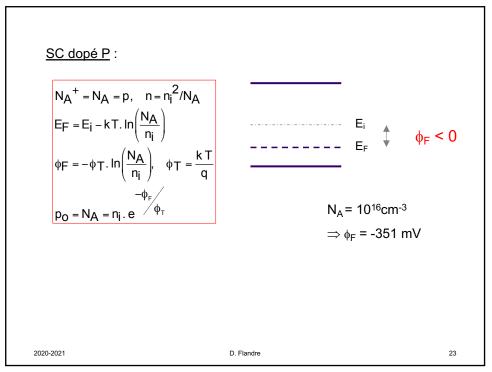
 $E_{\rm F}$ $\Phi_{\rm F} > 0$

exemple: pour Si, N_D = 10^{17} cm⁻³ $\Rightarrow \phi_F$ = 410 mV

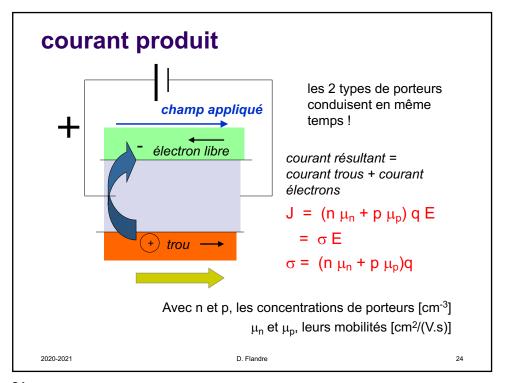
2020-2021 D. Flandre

,

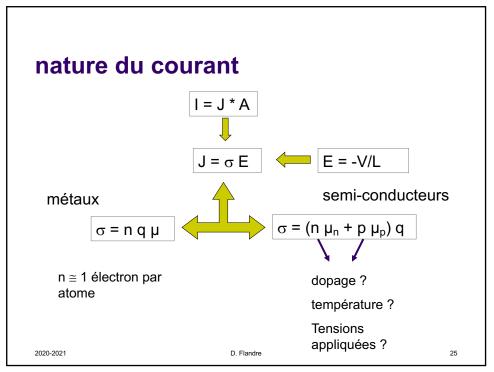
22



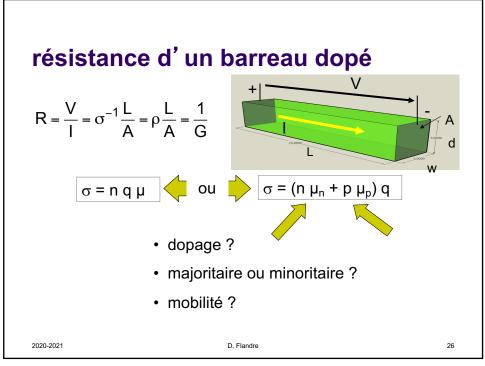
23



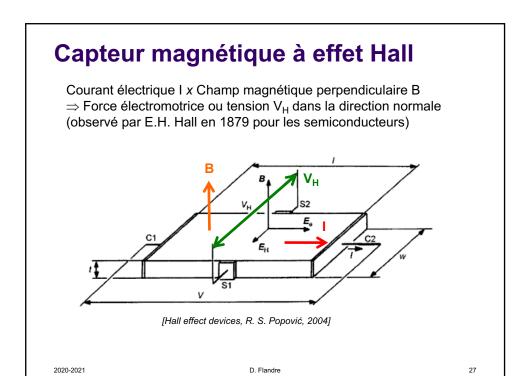
24



25

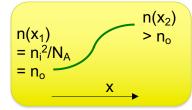


26

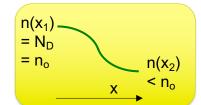


27





Excès de minoritaires (déficit existe aussi)



Déficit (*déplétion*) de majoritaires (excès (*accumulation*) existe aussi)

n(x₂) dépend du potentiel selon une loi de type Boltzman (similaire au dopage)

$$n = n_0 e^{\frac{\Delta \phi(x)}{\phi_T}} \longrightarrow n' = n - n_0 = n_0 \left[e^{\frac{\Delta \phi(x)}{\phi_T}} - 1 \right]$$

φ(x) positif : augmente la concentration locale d'électrons

 $(\phi(x) \text{ négatif} \rightarrow n \text{ diminue})$

D. Flandre

28

28

idem pour les trous

 $\Delta \phi(x)$ positif (*négatif*):

diminue (augmente) la concentration locale de trous

$$p = p_0 e \xrightarrow{\frac{-\Delta \phi(x)}{\phi_T}} \boxed{p' = p - p_0 = p_0} \begin{bmatrix} \frac{-\Delta \phi(x)}{\phi_T} \\ -1 \end{bmatrix}$$

même une légère tension peut modifier considérablement la concentration en porteurs

Ex.: $N_D = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$, $\Delta \phi(x) = -120 \text{ mV}$

 \Rightarrow n \approx 10¹⁵ cm⁻³ p \approx 10⁵ cm⁻³

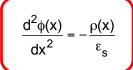
2020-2021 D. Flandre

29

équation de Poisson cas unidimensionnel

 $\rho(x) = q [p(x) - n(x) - N_A + N_D]$

Relation entre ϕ et charge :



 $\varepsilon_{\rm s}$ = permittivité diélectrique \approx 1 pF/cm pour Si

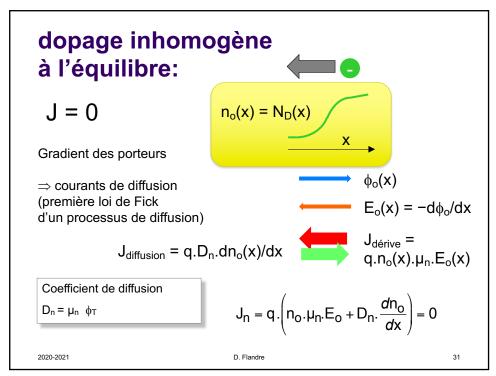
champ électrique

$$E(x) = -\frac{d\phi(x)}{dx} = \frac{1}{\epsilon_s} \int_{-\infty}^{x} \rho(x) dx$$

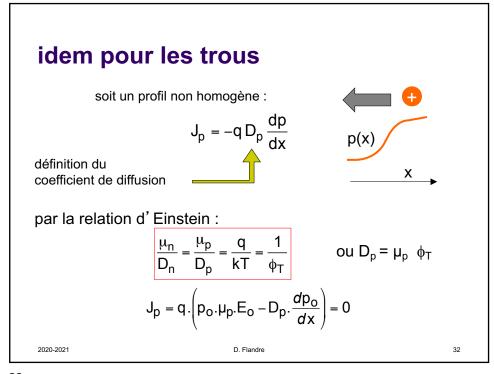
Neutralité électrique globale conservée si $E(x_2) - E(x_1) = 0$!

2020-2021 D. Flandre 30

30



31



32

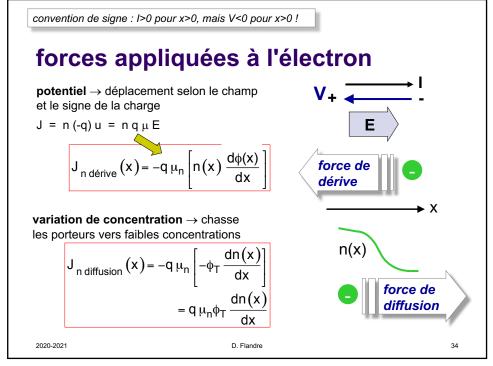
équations de base des semi-conducteurs

statique et dynamique des porteurs sous l'effet de champs externes

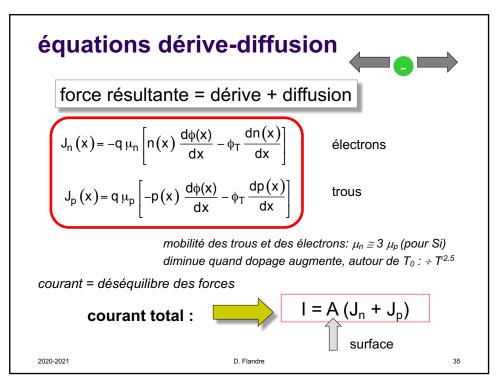
- équations de la densité de courant (dérive-diffusion)
- équations de Maxwell pour les milieux homogènes et isotropiques
 - ici l' équation de Poisson : $\nabla \times \mathcal{D} = \rho(x,y,z)$
- équation de continuité

2020-2021 D. Flandre 33

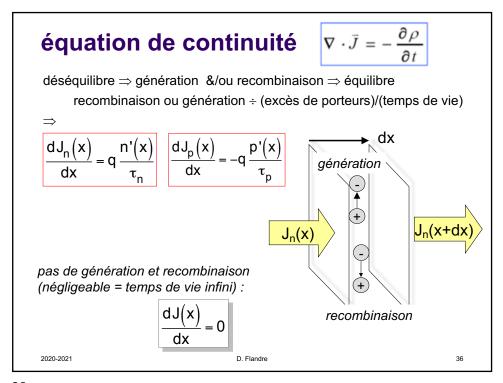
33



34



35



36

génération extérieure

(lumière, radiations...) \Rightarrow termes G_n et G_p

+ temps

$$\begin{split} &\frac{\partial n}{\partial t} = +\frac{1}{q}.\frac{dJ_n}{dx} + G_n - U_n \\ &\frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{1}{q}.\frac{dJ_p}{dx} + G_p - U_p \\ &U_n = \frac{n(x) - n_o}{\tau_n}, \quad U_p = \frac{p(x) - p_o}{\tau_p} \end{split}$$

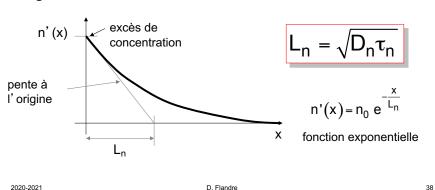
0-2021 D

37

temps de vie et longueur de diffusion

si, dans une portion de silicium, la recombinaison est négligeable, le temps de vie est infini

si la recombinaison n' est pas négligeable, on définit une **longueur de diffusion**, sous l' effet de l' excès de concentration :



38